

2014年10月22日

三井化学株式会社

ナノインプリント技術国際会議にてフッ素系材料「FROMP™」の開発を発表

三井化学株式会社（社長：淡輪 敏）は、10月22日（水）から24日（金）にかけて開催される、第13回ナノインプリント・ナノプリント技術国際会議にて、超高精細なナノインプリント*を実現する材料「FROMP™」の開発について発表いたします。

*ナノインプリント：ナノサイズのパターンを転写により成形するための型で、高精細化に伴い、半導体や光デバイスなどのへの応用も期待される

記

発表日時：2014年10月23日（木）16:00-

場所：ANA クラウンプラザホテル京都（京都府京都市中京区）

会議名：第13回ナノインプリント・ナノプリント技術国際会議（略称 NNT2014）

発表内容：ナノインプリント材料に適したフッ素系開発材料 FROMP™ を紹介します

特徴

- ・優れた透明性、耐光性：UV硬化型の材料に用いることが可能になります
- ・易離形性：様々な材料からの離形が容易で、幅広い材料の型に用いることができます
- ・硬化時の収縮なし：マザーモールドのパターンを、正確にレプリカモールドへ転写します
- ・L & S(ライン&スペース) 40nm：パターン精度が保てるサイズで、超高精細を達成

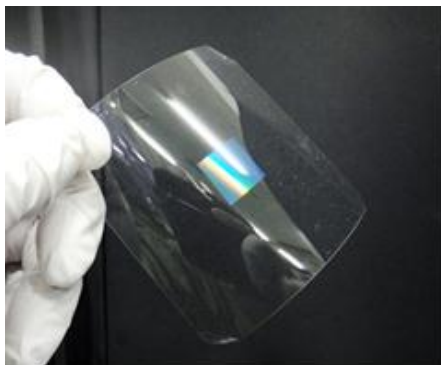


図1) FROMP™を用いたナノインプリント
(フィルムの中心部分)

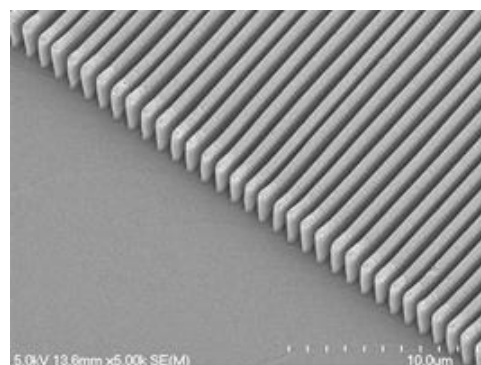


図2) ナノインプリント部分の拡大図
(モールドに刻まれたラインの太さ、間隔は約40nm)

FROMP™ は、当社の触媒技術を駆使し、ナノインプリントのレプリカモールドに最適な仕様となるように分子構造を設計しています。

今後も、更なる高機能・高付加価値製品を開発し、皆様にご提案してまいります。

以上

<本件に関するお問い合わせ先>

三井化学株式会社 IR・広報部 TEL 03-6253-2100